

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年6月23日(2005.6.23)

【公開番号】特開2003-203767(P2003-203767A)

【公開日】平成15年7月18日(2003.7.18)

【出願番号】特願2002-1052(P2002-1052)

【国際特許分類第7版】

H 05 B 33/10

C 23 C 14/04

H 05 B 33/12

H 05 B 33/14

【F I】

H 05 B 33/10

C 23 C 14/04 A

H 05 B 33/12 B

H 05 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成16年9月27日(2004.9.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

電極材料層間に発光材料層を挟持してなる発光素子が設けられた複数の画素を、基板上に配列形成してなる表示装置の製造方法であつて、

蒸着マスクの一面側に蒸着源を配置し、前記蒸着マスクの他面側に前記基板を配置し、蒸着マスクの各開口部から、前記基板における第1方向に配列された複数の画素を一括して露出させた状態で、当該第1方向と直交する第2方向に、前記蒸着マスクと前記基板とを前記蒸着源に対して相対的に移動させることで、前記基板上の各画素に前記発光材料層の蒸着パターンを形成することを特徴とする、

表示装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

蒸着マスクの一面側に蒸着源を配置し、前記蒸着マスクの他面側に基板を配置し、当該蒸着マスクと基板とを前記蒸着源に対して相対的に移動させることで、前記基板上の各画素に発光素子を構成する材料層の蒸着パターンを形成する際に用いる蒸着マスクであつて、

前記基板における一方に配列された複数の画素を一括して露出させる開口部を備えたことを特徴とする蒸着マスク。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】**【0014】**

また、本発明の表示装置の製造方法は、電極材料層間に発光材料層を挟持してなる発光素子が設けられた複数の画素を、基板上に配列形成してなる表示装置の製造方法である。本発明においては、蒸着マスクの一面側に蒸着源を配置し、前記蒸着マスクの他面側に前記基板を配置し、蒸着マスクの各開口部から、前記基板における第1方向に配列された複数の画素を一括して露出させた状態で、当該第1方向と直交する第2方向に、前記蒸着マスクと前記基板とを前記蒸着源に対して相対的に移動させることで、前記基板上の各画素に前記発光材料層の蒸着パターンを形成することを特徴としている。